

2011年度・第35回学術講演会・セッション一覧(新潟コンベンションセンター)

		9/27(火)			
		9:00-12:00		13:00-18:00	
A 会場 国際会議 230席		第177回 研究会「最先端情報ストレージ技術」			
		10:00~11:30	13:00~15:00	15:15~16:15	
B 会場 中会議室 201 230席		高スピン分極材料	ホイスラー合金(MR)	磁壁移動	ナノマグネティックス
		10:15~11:45	13:00~14:00	14:15~15:45	16:00~17:30
C 会場 中会議室 301A 124席	磁石膜 I 9:45~10:45	磁石膜 II 11:00~12:00	Symposium "Rare Earth Saving Technology in Recent Permanent Magnets"		
			13:00~15:00	15:15~16:45	
D 会場 中会議室 301B 124席		磁気センサ	顕微鏡技術 I	顕微鏡技術 II	電磁非破壊検査
		9:30~11:30	12:45~14:30	14:45~16:30	16:45~18:00
E 会場 中会議室 302A 124席	表面・界面・グラフェン 9:15~10:30	交換バイアス	グラニュー膜	微粒子 I	微粒子 II
		10:45~12:00	13:00~14:30	14:45~16:15	16:30~17:30
F 会場 中会議室 302B 124席		医療・治療技術	生体磁気計測	磁場発生・磁気シールド	ハイパーサーミア
		10:30~12:00	13:00~14:15	14:30~15:30	15:45~17:15

		9/28(水)			
		9:00-12:00		13:00-18:00	
A 会場 国際会議 230席	磁気ヘッド 9:00~10:15	エネルギーアシスト記録 I	エネルギーアシスト記録 II	表彰式ならびに特別講演 会場 朱鷺メッセ 国際会議場 表彰式 15:00~16:00 特別講演 16:00~17:00 講師 永田 尚志 先生 「佐渡島において放鳥されたトキの生態」 懇親会 18:00~	
		10:30~12:00	13:00~14:30		
B 会場 中会議室 201 230席		磁気抵抗効果 I	磁気抵抗効果 II		
		9:45~11:45	12:45~14:30		
C 会場 中会議室 301A 124席	希土類磁石 I 9:30~10:30	希土類磁石 II	希土類磁石 III		
		10:45~12:00	13:00~14:30		
D 会場 中会議室 301B 124席	Symposium "Low Invasive Diagnosis and Therapy Using Magnetics"				
	9:00~10:30	10:45~12:15			
E 会場 中会議室 302A 124席		磁性ドット	薄膜 I (磁壁)		
		10:00~11:45	13:15~14:30		
F 会場 中会議室 302B 124席	高周波デバイス I 9:30~10:30	高周波デバイス II	光・電磁波制御		
		10:45~12:00	13:00~14:30		

プログラムはWEBサイトにてご確認ください。http://www.wdc-jp.com/msj/kouenkai/2011/program.html

	9/29(木)				
	9:00-12:00		13:00-18:00		
A 会場 国際会議 230席	磁気記録媒体 I 9:15~10:30	磁気記録媒体 II 10:45~11:45	磁気記録媒体 III 13:00~14:00	磁気記録再生特性 14:15~15:00	計算機シミュレーション (磁気記録) 15:15~16:15
B 会場 中会議室 201 230席		スピントルクデバイス 9:45~11:30	スピン流 13:00~14:30	スピン注入磁化反転 14:45~16:15	磁化ダイナミクス 16:30~18:00
C 会場 中会議室 301A 124席	非接触電力伝送 9:45~10:45	磁気アクチュエータ 11:00~12:00	パワーマグネティクス I 13:30~14:45	パワーマグネティクス II 15:00~16:15	電磁界解析 16:30~17:30
D 会場 中会議室 301B 124席			Symposium "Magnetic and Magneto-Transport Properties in Graphene" 13:00~14:30		
E 会場 中会議室 302A 124席	強磁場応用 9:15~10:15	マルチフェロイックス 10:30~12:00	磁気光学 I 13:00~14:15	磁気光学 II 14:30~15:45	磁歪・磁気異方性 16:00~17:45
F 会場 中会議室 302B 124席	薄膜 II (交換結合、結晶成長) 9:15~10:30	薄膜 III (結晶成長) 10:45~12:00	薄膜 IV (強磁性共鳴) 13:00~14:45	薄膜 V (磁気異方性) 15:00~16:30	

	9/30(金)				
	9:00-12:00		13:00-18:00		
A 会場 国際会議 230席	パターンド媒体 I 9:00~10:00	パターンド媒体 II 10:15~11:30			
B 会場 中会議室 201 230席	半導体スピン注入 I 9:00~10:00	半導体スピン注入 II 10:15~11:30			
C 会場 中会議室 301A 124席	磁気渦・磁化過程 9:00~10:30				
D 会場 中会議室 301B 124席	ソフト材料 I (金属系, 磁気特性) 9:00~10:30	ソフト材料 II (フェライト系, 高周波特性) 10:45~11:45			
E 会場 中会議室 302A 124席					
F 会場 中会議室 302B 124席					